2008年12月17日, 18日 原子分子データ応用フォーラムセミナー 核融合科学研究所

生体分子の放射線損傷における原子分子過程 (1)XFELによる生体分子の損傷 (2)重粒子線の生体中の原子過程

森林 健悟

日本原子力研究開発機構、量子ビーム応用研究部門 光量子シミュレーション研究グループ

(1) XFELによる生体分子の損傷



日本のXFELとその特徴



兵庫県播磨市

XFELの特徴(第3回XFELシンポジウムより):

- ・コヒーレント
- ・短パルス(10~100 fs)
- 高輝度(SPring 8の10億倍以上)
- •短波長(0.1~0.06 nm)



X線の散乱でタンパク質の原子の3次元の配置(立体構造)を調べる

タンパク質の立体構造→機能の予測→薬の開発等で重要



立体構造決定手法の開発に向けた理論的基盤の確立



XFELによる生体分子損傷のメカニズム



パルス幅: 10 fs、波長: 1 Åの場合





 N_{i} ; population of state i



パルス幅と波長 (λ) 依存性





共同研究者

郷 信広 教授
甲斐 健史 博士
福田 佑二 博士
河野 秀俊 博士
徳久 淳師 博士
(原子力機構)

「X線自由電子レーザー利用推進課題研究」 (文部科学) 省) にサポートされてます。

(2)重粒子線の生体中の原子過程

重粒子線のがん治療



生物学的効果比(RBE)



重粒子線は大きなRBE値を持つが、その理由は わかっていない。

酸素增感比(OER)



X線(γ線)によるDNA損傷のメカニズム



重粒子線のDNA損傷のメカニズム



重粒子線の生体中での振る舞い



■阻止能(S)の定義

$$S = -\frac{dE}{dr}$$
 r:入射距離、E:粒子のエネルギー

低エネルギー領域の重粒子線に対する電子阻止能の研究

高エネルギー領域(1MeV/u以上)
 阻止能:Bethe-Bloch理論から求める:
 衝突電離過程をfirst Born近似で求めたもの

・低エネルギー領域(数keV~1MeV)

電離衝突だけでなく、電荷移行、励起、電子損失過程が重要となる (原子過程データが不足) 陽子: S. Uehara et al., Rad. Phys. Chem. **59**, 1(2000) α線: S.Uehara and H.Nikjoo, J. Phys. Chem., 106, 11051(2002)

それ以外:なし(上の文献によれば)

▼ 入射粒子:リチウムーネオンイオン 入射エネルギー:数keV/u-1MeV/uを対象とした研究を行う。

阻止能計算に必要な原子分子過程(1):衝突電離過程



阻止能計算に必要な原子分子過程(2):電荷移行過程





阻止能計算に必要な原子分子過程(3):電子損失過程

電子損失 $A^{z+} + B \rightarrow A^{(z+1)+} + B$

電荷数は電荷移行(CT)と電子損失(EL)により決まる。 CT:電荷数を減らす EL:電荷数を増やす



原子分子過程:まとめ

阻止能計算 ◎電離: $A^{z+} + B \rightarrow A^{z+} + B + e^{-}$ ◎電荷移行: $A^{z+} + B \rightarrow A^{(z-1)+} + B^{+}$ ◎電子損失 $A^{z+} + B \rightarrow A^{(z+1)+} + B$ ◎衝突励起過程: $A^{z+} + B \rightarrow A^{z+} + B^{*}$

DNA損傷

 \bigcirc **M m m** : H₂O+e⁻ → OH + H +e⁻

その他

- ◎放射遷移: $A^{z+*} \rightarrow A^{z+} + hv$ ◎自動イオン化: $A^{z+**} \rightarrow A^{(z+1)+} + e$ ◎多重電荷移行、多重電離:
- - 2つ以上の電子が電荷移行、電離を一度に起こす過程

2MeV/uの重粒子線に対する阻止能と平均電荷数vs. 侵入距離 標的: 10²²/cm³の密度のH₂分子



(1)XFELによる生体分子の損傷 XFELの様々なパラメータに対して電荷数の時間発展の 計算結果を様々な原子過程を用いて求めた。 →XFELに必要な実験パラメータを導出した。

(2)重粒子線の生体中の原子過程 重粒子線の生体中で重要な原子過程を示した。